

Установка совмещения и экспонирования AG500-4N-SLC / AG500-6N-SLC

Image not found or type unknown



Производитель:

M&R Nano Technology

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установки совмещения и экспонирования серии AG500-4N-SLC / AG500-6N-SLC являются надежным, гибким и бюджетным инструментом для решения практически полного спектра задач фотолитографии. Компактные, удобные в эксплуатации и обслуживании установки превосходно удовлетворят потребности опытных и пилотных производств, лабораторий и исследовательских центров. Оборудование предназначено для работы с пластинами до 100/150 мм.

Установки AG500-4N-SLC / AG500-6N-SLC представляют собой “облегченный” компактный вариант моделей AG500-4N-ST / AG500-6N-ST. Данное оборудование для фотолитографии размещается на промышленном столе, позволяет работать с пластинам 60x48 мм и круглыми пластинами до 4”/6”. Опция совмещения по обратной стороне недоступна для этой модели.

	AG500-4N-SLC	AG500-6N-SLC
Источник света	Ультрафиолетовая лампа	
Длина волны, нм	350-450	
Мощность лампы, Вт	350/500	500
Время жизни лампы, ч	>1000	
Интенсивность освещения, мВт/см ²	≥20 (365) ≥35 (405)	≥25 (365) ≥40(405)
Равномерность освещения, %	<±3	
Диаметр эффективной освещаемой зоны, мм	>100	>150
Режимы экспонирования	Вакуумный, жесткий или мягкий контакт, микрозазор	
Разрешение, мкм	Вакуумный контакт: <1 Жесткий/мягкий контакт: 1-2 Микрозазор: ≤5	
Размер обрабатываемых подложек, мм	60x48, 50,75,100 (другой размер под заказ)	60x48, 50,75,100,150 (другой размер под заказ)

Максимальный размер фотошаблона, мм ²	До 127x127	До 178x178
Максимальный зазор, мкм	1000	
Шаг выставления зазора, мкм	1	
Система оптического совмещения	Двупольный видеомикроскоп	
Совмещение по обратной стороне	Не предусмотрено	
Точность прямого совмещения, мкм	±1	
Система управления	Полностью ручная	
Виброизоляция	Опция	
Габариты (ШхГхВ), мм	~750x750x1200	

Есть в наличии на складе в Санкт-Петербурге!

Подробности у наших менеджеров.